

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005年1月13日 (13.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/004229 A1

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 21/68, 21/3065, H02N 13/00

(74) 代理人: 小野寺 洋二 (ONODERA,Yoji); 〒104-0032 東京都 中央区 八丁堀三丁目 9 番 8 号 新京橋第一長岡ビル Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/009346

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(22) 国際出願日: 2004年6月25日 (25.06.2004)

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願2003-193479 2003年7月8日 (08.07.2003) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会社 フューチャービジョン (FUTURE VISION INC.) [JP/JP]; 〒107-0052 東京都 港区 赤坂2丁目4番1号 白亜ビル3F Tokyo (JP).

(72) 発明者; および  
(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 小林 聰樹 (KOBAYASHI,Toshiki) [JP/JP]; 〒220-0101 神奈川県 津久井郡 城山町町屋1丁目2番41号 東京エレクトロンAT株式会社内 Kanagawa (JP). 岩瀬 勝彦 (IWABUCHI,Katsuhiro) [JP/JP]; 〒220-0101 神奈川県 津久井郡 城山町町屋1丁目2番41号 東京エレクトロンAT株式会社内 Kanagawa (JP).

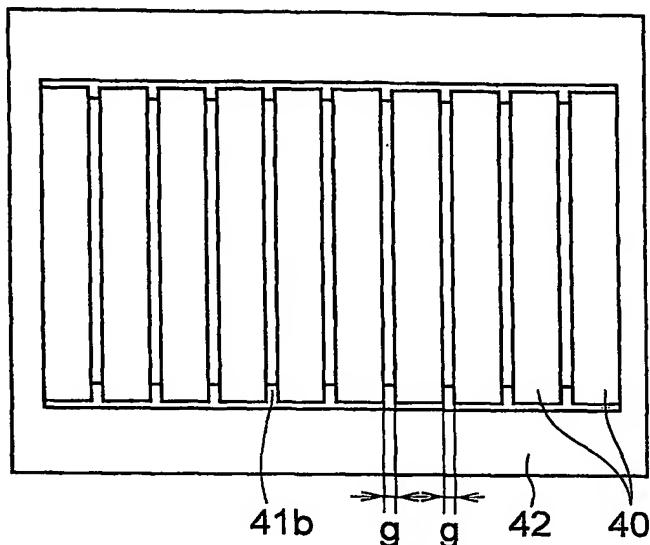
添付公開書類:

— 國際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: ELECTROSTATIC CHUCK FOR SUBSTRATE STAGE, ELECTRODE USED FOR THE CHUCK, AND TREATING SYSTEM HAVING THE CHUCK AND THE ELECTRODE

(54) 発明の名称: 基板ステージ用静電チャック及びそれに用いる電極ならびにそれらを備えた処理システム



(57) Abstract: An electrostatic chuck for a substrate stage, wherein highly pure ceramics is thermally sprayed on the surfaces of bar-like base materials to form a single layer thermally sprayed film so as to form electrodes. The plurality of electrodes are arranged at specified intervals.

(57) 要約: 棒状の基材の表面に高純度セラミックスを溶射して単層の溶射膜を形成して電極を構成し、複数の該電極を隙間を保って配置した基板ステージ用静電チャックとする。



2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。